SEMICONDUCTOR WAFER FIXING SHEET

Publication number: JP10150007 (A)

Publication date: 1998-06-02

Inventor(s):

SAIDA SEIJI; UCHIDA HIROYUKI; WADA SHIGERU; HAYASHI TAKASHI +

Applicant(s):

TOYO CHEMICALS CO LTD +

Classification:

- international:

C09J155/00; C09J7/02; H01L21/301; C09J155/00; C09J7/02; H01L21/02; (IPC1-

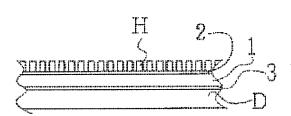
7): C09J155/00; C09J7/02; H01L21/301

- European:

Application number: JP19960322315 19961118 **Priority number(s):** JP19960322315 19961118

Abstract of JP 10150007 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To easily remove a chip at the time of picking it up by using pressure sensitive adhesives whose adhesive strength is respectively reduced only by different adhesive strength reducing means for a pressure sensitive adhesive layer for fixing a semiconductor wafer and a pressure sensitive adhesive layer for fixing the position. SOLUTION: A major part is composed of a semiconductor wafer fixing pressure sensitive adhesive layer 2 composed of thermosetting pressure sensitive adhesive laminated on one plane of a supporting body 1 and a sheet fixing pressure sensitive adhesive layer 3 composed of UV hardening pressure sensitive adhesive laminated on the other plane. The supporting body 1 is formed of polyethyleneterephthalate. The pressure sensitive adhesive layer 2 is formed of thermosetting pressure sensitive adhesive, and the pressure sensitive adhesive layer 3 is formed of UV hardening pressure sensitive adhesive. Thus, semiconductor chips can be removed from the semiconductor wafer fixing sheet after dicing without scattering them.



Data supplied from the **espacenet** database — Worldwide

(19)日本国特許广(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-150007

(43)公開日 平成10年(1998)6月2日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I	
H 0 1 L 21/301		H01L 21/78	M
C 0 9 J 7/02		C 0 9 J 7/02	Z
155/00		155/00	

審査請求 未請求 請求項の数4 FD (全 7 頁)

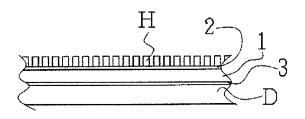
(21)出願番号	特願平8-322315	(71)出願人	000222532
			東洋化学株式会社
(22)出願日	平成8年(1996)11月18日		神奈川県鎌倉市台2丁目13番1号
		(72)発明者	齊田 誠二
			神奈川県鎌倉市台2丁目13番1号 東洋化
			学株式会社内
		(72)発明者	内田 弘之
			神奈川県鎌倉市台2丁目13番1号 東洋化
			学株式会社内
		(72)発明者	和田 茂
			神奈川県鎌倉市台2丁目13番1号 東洋化
			学株式会社内
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 半導体ウエハ固定用シート

(57)【要約】

【課題】従来の加熱硬化型又は紫外線照射型粘着剤を使 用した半導体ウエハ固定用シートにあっては、位置固定 用粘着剤層の粘着力を低下させて該半導体固定用シート をピツクアツプ装置の位置固定台から剥離しようとする と、チツブとなった半導体が該シートから離散してしま うという課題があった。。

【解決手段】位置固定用粘着剤層2と半導体ウエハ固定 用粘着剤層3のそれぞれの粘着剤として、別々の粘着力 低下手段でしか粘着力を低下させない粘着剤を採用す る。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 シート状の支持体(1)と、該支持体(1)の一方の面に積層された半導体ウエハ固定用粘着剤層(2)と、該支持体(1)の他方の面に積層されたシート固定用粘着剤層(3)で主要部が構成された半導体ウエハ固定用シートにおいて、前記半導体ウエハ固定用粘着剤層(2)又は前記シート固定用粘着剤層(3)のいずれか一方が加熱硬化型粘着剤であり、他方が紫外線硬化型粘着剤であることを特徴とする半導体ウエハ固定用シート。

【請求項2】 上記加熱硬化型粘着剤の主成分が、ベースポリマ100重量部、オリゴマ及び/又はモノマ5~900重量部及び加熱重合開始剤0.1~10重量部を主成分とすることを特徴とする請求項1記載の半導体ウエハ固定用シート。

【請求項3】 上記紫外線硬化型粘着剤が、ベースポリマ100重量部、オリゴマ及び/又はモノマ5~900重量部及び紫外線重合開始剤0.1~5重量部を主成分とすることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の半導体ウエハ固定用シート。

【請求項4】 上記オリゴマ及び/又はモノマが、ウレ タンアクリレート系オリゴマであることを特徴とする請 求項2又は請求項3記載の半導体ウエハ固定用シート。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、両面に粘着剂層が 積層され、一方の粘着剤層で板状の半導体ウエハを保持 し、他方の粘着剤層で固定台に粘着する半導体ウエハ固 定用シートに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、半導体ウエハ固定用シートは、図2に示すように、シート状の支持体Sの両面に粘着剤層A、Bが積層されたものであり、一方の半導体ウエハ固定用粘着剤層Aで板状の半導体ウエハHを保持し、他方のシート固定用粘着剤層Bで固定台Dに安定的に位置固定されるものである。また、この固定台Dは、半導体ウエハHをダイシングしてチップ化するダイシング装置の一部であり、かかる固定台Dでの位置固定は極めて精密でなくてはならない。

【0003】ここで、半導体ウエハ固定用粘着剤層Aは、半導体ウエハ日をダイシング時に強固に粘着すると共に半導体ウエハHのチツプをピツクアツプする際には容易に離脱させなければならない。上記シート固定用粘着剤層Bは、ダイシング時の衝撃を受けても半導体ウエハHの位置を維持する粘着力を持つ一方、図2に示すように、ダイシング後には該固定台Dと剥離可能でなければならない。

【0004】したがって、該半導体ウエハ固定用シートは、ダイシング時には高い粘着力が必要される一方、前記固定台からの剥離時とピツクアツプ時には低い粘着力

が要求される。

【0005】かかる要求に対し、本出願人は、ダイシング時の粘着力を加熱又は紫外線照射によって低下させることのできる半導体ウエハ固定用シートを、開示している(特願平8-170624号、特願平8-198402号)。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、位置固定用粘着剤層の粘着力を低下させて該半導体固定用シートをピツクアツプ装置の固定台から剥離しようとすると、チツプとなった半導体が該シートから離散してしまうという課題があった。これは、シート固定用粘着剤層の粘着力を加熱又は紫外線照射によって低下させる際に半導体ウエハ固定用粘着剤の粘着力をも低下させていたためである。

【0007】したがって、本発明の目的は、ダイシング後の粘着力低下手段を受けてもチツプを離脱させることなく固定台から剥離され、チツプピツクアツプ時にはチップを容易に離脱させることのできる半導体ウエハ固定用シートを提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明者は、上記に鑑み 鋭意検討を行った結果、半導体ウエハ固定用と位置固定 用の粘着剤層のそれぞれに別々の粘着力低下手段でしか 粘着力を低下させない粘着剤を採用することにより上記 課題を解決できることを見出だし、本発明を完成させ た。

【0009】すなわち、本発明にかかる半導体ウエハ固定用シートは、シート状の支持体と、該支持体の一方の面に積層された半導体ウエハ固定用粘着剤層と、該支持体の他方の面に積層されたシート固定用粘着剤層で主要部が構成された半導体ウエハ固定用シートにおいて、前記半導体ウエハ固定用粘着剤層又は前記シート固定用粘着剤層の一方を加熱硬化型粘着剤で形成し、他方を紫外線硬化型粘着剤で形成したものである。

【0010】ここで、一方の粘着剤層を加熱硬化型、他方の粘着剤を紫外線硬化型にしたのは、シート固定用の粘着剤の粘着力のみを低下させた後、半導体ウエハ固定用粘着剤の粘着力を低下させるためである。

【0011】本発明における加熱硬化型粘着剤、紫外線硬化型粘着剤は、従来公知の種々のものを採用できる。また、これらは、共に主剤であるベースポリマで粘着力を発揮させ、オリゴマ及び/又はモノマで該粘着力を低下させるものであり、この粘着力を低下させる開始剤として、加熱重合開始剤を配合すれば加熱硬化型粘着剤になり、紫外線重合開始剤を配合すれば紫外線硬化型粘着剤になるものである。

【0012】ここで、上記紫外線硬化型粘着剤、加熱硬化型粘着剤の粘着力が低下するのは、70~150℃の熱処理を受けた加熱重合開始剤又は紫外線を受けた紫外

線重合開始剤によって粘着剤全体が三次元網目状構造に なって硬化するためである。

【0013】粘着力の具体的な値としては、加熱又は紫外線照射前には100~3000gf/20mm(剥離速度300mm/分)の範囲内にある180度剥離接着力(JIS Z 0237)が、加熱又は紫外線照射後には0~50gf/20mm(剥離速度300mm/分)になるのが好ましい。なお、紫外線硬化型粘着剤の粘着力をかかる値に設定するためには、ベースポリマ100重量部、オリゴマ及び/又はモノマ5~900重量部及び紫外線重合開始剤0.1~5重量部を主成分にするのが好ましく、加熱硬化型粘着剤の粘着力をかかる値に設定するには、ベースポリマ100重量部、オリゴマ及び/又はモノマ5~900重量部及び加熱重合開始剤0.1~10重量部を主成分にするのが好ましい。

【0014】粘着力低下手段としての加熱手段は、該半導体ウエハ固定用シートを70~150℃にするものであれば適宜採用でき、特に限定するわけではないが、例えばオーブンや温風ヒータ、電熱ヒータ等がある。また、紫外線照射手段は、従来公知の紫外線照射装置を採用することができる。

【0015】ここで、本発明で特徴となる配合部材の上記加熱重合開始剤としては、加熱を受けた際に上記オリゴマ及び/又はモノマを硬化させることにより粘着剤全体を硬化させてその粘着力を低下させるためのものであり、その配合比はあまりに多いと熱に敏感になり環境温度の変化で硬化してしまい保存安定性が悪く、さらには製品製造時の乾燥工程(100 $^{\circ}$ 、1分)だけで硬化してしまい製品としての要求品質を得られなくなり、あまりに少ないと硬化が遅く作業性に劣るため、好ましくは0.1 $^{\circ}$ 10重量部、さらに好ましくは0.5 $^{\circ}$ 5

【0016】該加熱重合開始剤としては、有機過酸化物 誘導体、アゾ系重合開始剤があり、アゾ系重合開始剤は 加熱時に窒素が発生するため有機過酸化物誘導体の方が 好ましい。該加熱重合開始剤の具体的な例としては、ケ トンパーオキサイド、パーオキシケタール、ハイドロパ ーオキサイド、ジアルキルパーオキサイド、ジアシルパ ーオキサイド、パーオキシエステル、パーオキシジカー ボネート、アゾビスイソブチロニトリル等がある。ま た、必要に応じてトリエチルアミン、テトラエチルペン タアミン、ジメチルアミノエーテル等のアミン化合物を 重合促進剤として併用しても良い。

【0017】また、上記紫外線重合開始剤としては、紫外線照射を受けた際に上記オリゴマ及び/又はモノマを硬化させることにより粘着剤全体を硬化させてその粘着力を低下させるためのものであり、この配合比はあまりに多いと光に敏感になり保存安定性が悪くなり、あまりに少ないと硬化が遅く作業性に劣るため、好ましくは0.1~5重量部、さらに好ましくは1~3重量部がよ

W.

【0018】該紫外線重合開始剤としては、具体的にはベンゾイン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインイソプロピルエーテル、ベンジルジフエニルサルフアイド、テトラメチルチウラムモノサルフアイド、アゾビスイソブチロニトリル、ジベンジル、ジアセチル、β-クロールアンスラキノン等がある。また、該紫外線重合開始剤には、必要に応じてトリエチルアミン、テトラエチルペンタアミン、ジメチルアミノエーテル等のアミン化合物を光重合促進剤として併用しても良い。

【0019】前記紫外線重合開始剤に重合禁止剤を配合することにより意図しない重合(例えば熱による重合)を防止させることもできる。この重合禁止剤としては、ピクリン酸、フエノール、ハイドロキノン、ハイドルキノンモノメチルエーテル等がある。

【0020】本発明にかかる上記オリゴマ及び/又はモノマとしては、加熱された加熱重合開始剤又は紫外線照射を受けた紫外線重合開始剤によって三次元網状化しうる分子内に、光重合性炭素一炭素三重結合を少なくとも二個以上有する低分子量化合物があり、具体的にはアクリレート系化合物、ウレタンアクリレート系オリゴマ等がある。このオリゴマ及び/又はモノマが三次元網状化することによって、粘着剤全体を硬化し粘着力を低下させることができる。

【0021】本発明におけるオリゴマ及び/又はモノマの配合比は、あまりに多いと熱や光に敏感になり環境温度や日常の光で硬化してしまい保存安定性が悪く、さらには製品製造時の乾燥工程(100 $^{\circ}$ 、1分)だけで硬化してしまい製品としての要求品質を得られなくなり、また、あまりに少ないと硬化が遅く粘着力低下効率が悪くなるため、好ましくは5 $^{\circ}$ 00重量部、さらに好ましくは20 $^{\circ}$ 200重量部がよい。

【0022】前記アクリレート系化合物としては、例えばトリメチロールプロパントリアクリレート、テトラメチロールメタンテトラアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレート、ジペンタエリスリトールモノヒドロキシペンタアクリレート、ジペンタエリスリトールへキサアクリレートあるいは1、4ーブチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポリエチレングリコールジアクリレート、ポフクリレート等がある。

【0023】一方、ウレタンアクリレート系オリゴマは、炭素一炭素二重結合を少なくとも二個以上有する加熱及び/又は紫外線硬化性化合物であり、例えばポリエステル型又はポリエーテル型等のポリオール化合物と、多価イソシアネート化合物例えば2,4ートリレンジイソシアナート、2,6ートリレンジイソシアナート、1,3ーキシリレンジイソシアナート、1,4ーキシリ

レンジイソシアナート、ジフエニルメタン4、4ージイソシアナート等を反応させて得られる末端イソシアナートウレタンプレポリマに、ヒドロキシル基を有するアクリレートあるいは、メタクリレート例えば2ーヒドロキシエチルアクリレート、2ーヒドロキシプロピルアクリレート、2ーヒドロキシプロピルメタクリレート、ポリエチレングリコールアクリレート、ポリエチレングリコールメタクリレート等を反応させて得られるものがある。

【0024】また、前記ウレタンアクリレート系オリゴマを採用する場合、特に分子量が300~30000、好ましくは1000~8000であるものを半導体ウエハ固定用粘着剤層に用いると、半導体ウエハ表面が粗くてもチツプのピツクアツプ時に粘着剤がチツプに付着することがなく、位置固定用粘着剤層に用いると、粘着剤が固定台に残らない。

【0025】本発明におけるベースポリマとしては、一般に知られているアクリル系粘着剤、ゴム系粘着剤等を用いることができる。

【0026】該アクリル系粘着剤には、従来公知のアク リル系粘着剤を適宜選択して使用でき、一般的には、ア クリル酸エステル系を主たる構成単量体単位とする単独 重合体(主モノマ)及びコモノマとの共重合体から選ば れたアクリル系共重合体、その他の官能性単量体(官能 基含有モノマ)との共重合体及びこれら重合体の混合物 がある。ここで、上記主モノマとしては、ばエチルアク リレート、ブチルアクリレート、2-エチルヘキシルア クリレート等があり、上記コモノマとしては、酢酸ビニ ル、アクリルニトリル、アクリルアマイド、スチレン、 メチルメタクリレート、メチルアクリレート等がある。 また、上記官能基含有モノマとしては、メタクリル酸、 アクリル酸、イタコン酸、ヒドロキシエチルメタクリレ ート、ヒドロキシプロピルメタクリレート、ジメチルア ミノエチルメタクリレート、アクリルアマイド、メチロ ールアクリルアマイド、グリシジルメタクリレート、無 水マレイン酸等がある。

【0027】上記ゴム系粘着剤としては、例えば、天然ゴム、合成イソプレンゴム、スチレンブタジエンゴム、スチレンブタジエンゴム、スチレン・ブタジエンブロツク共重合体、スチレン・イソプレンブロツク共重合体、ブチルゴム、ポリイソブチレン、ポリブタジエン、ボリビニルエーテル、シリコーンゴム、ポリビニルイソブチルエーテル、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、クラフトゴム、再生ゴム、スチレン・プロピレン・ブチレン・ブロツクコポリマ、スチレン・プロピレン・ブチレン・ブロツクコポリマ、スチレン・イソプレン・ブロツクポリマ、アクリロニトリル・ブタジエン共重合体、アクリロニトリル・アクリルエステル共重合体、メチル・メタアクリレート・ブタジエン共重合体、ボリイソブチレン・エチレン・プロピレン共重合体、ボリイソブチレン・エチレン酢酸ビニル共重合体、ポリイソブチレン

・シリコンゴム、ポリビニルイソブチルエーテル・クロロプレン等があり、これらの単独物のみならず混合物であってもよい。

【0028】また、前記ゴム系粘着剤には粘着力を高め るため、粘着付与樹脂を加えることが好ましい。この粘 着付与樹脂としては、あまりに少ないとエラストマを主 成分とする粘着剤の粘着効果が出ず、あまりに多いと軟 らかくなりすぎて加熱又は紫外線照射をされても粘着力 が低下しなくなるため、主剤(ゴム系粘着剤)100重 量部に対して5~100重量部配合するのが好ましく、 さらに好ましくは10~30重量部配合するのがよい。 【0029】該粘着付与樹脂としては、ロジン系樹脂、 テルペン系樹脂、脂肪族系石油樹脂、芳香族系石油樹 脂、水添石油樹脂、クロマン・インデン樹脂、スチレン 系樹脂、アルキルフエノール樹脂、キシレン樹脂等の単 独物又は混合物があり、エラストマとの相溶性を考慮す るとテルペン系樹脂が好ましい。上記ロジン系樹脂とし ては、ロジン、重合ロジン、水添ロジン、ロジンエステ ル、水添ロジンエステル、ロジン変成フエノール樹脂等 があり、上記テルペン系樹脂としては、テルペン樹脂、 テルペンフエノール樹脂、芳香族変成テルペン樹脂、ロ ジンフエノール樹脂等がある。また、上記水添石油樹脂 としては、芳香族系のもの、ジシクロペンンタジエン系 のもの、脂肪族系のもの等がある。

【0030】上記半導体ウエハ固定用粘着剤層や上記シート固定用粘着剤層には、初期粘着力を任意に設定するために、必要に応じて硬化剤を配合することができる。該硬化剤の採用により、粘着剤として凝集力を高め、紫外線照射前(未照射)の状態でも貼り合わせ時の汚染(一旦粘着させたシートを剥離した際に、該シートの粘着剤が被粘着部材に残る状態)が生じず、再剥離性を得ることができる。また、該硬化剤は、あまりに少ないと前記汚染防止機能を発揮し得ず、あまりに多いと初期粘着力が低くなりダイシング時にチツブが飛んだり固定台から剥がれたりするため、該硬化剤は0.05~30重量部、好ましくは1.0~5.0重量部配合するのがよい。

【0031】上記半導体ウエハ固定用粘着剤層に上記硬化剤を採用すると共にベースポリマとしてエラストマを採用すると、加熱又は紫外線照射によって粘着力が低下させられても、前記エラストマ自身の分子骨格の軟らさによって固定台に粘着剤が移ったりしない。また、上記シート固定用粘着剤層に該硬化剤を採用すると共にベースポリマとしてエラストマを採用すると、該エラストマの分子骨格が軟らかさによって半導体ウエハにしっかりと貼り付きダイシング時にチツプをむやみに飛散せず安定してダイシングできる。また、チツプ飛散によるブレードの破損がなくなりブレードの耐久性が向上し、生産性向上につながる。

【0032】また、かかる硬化剤としては、イソシアネ

ート系、エポキシ系、アジリジン系等のもの等があり、これらの単独物のみならず混合物であってもよい。上記イソシアネートとしては、多価イソシアネート化合物、例えば2,4ートリレンジイソシアナート、2,6ートリレンジイソシアナート、1,3ーキシリレンジイソシアナート、ジフエニルメタンー4,4'ージイソシアナート、ジフエニルメタンー2,4'ージイソシアナート、ジシクロキシルメタンー2,4'ージイソシアナート、ジシクロンシート、フエニレンジイソシアナート、リジンクロロンジイソシアナート、リジンクロロンジイソシアナート、リジンクロンジイソシアオート、リジンクロンジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、ジフエニルメタジイソシアネート、トリレンジイソシアネート、ジフエニルメタジイソシアネート、シクロへキサンジイソシアネート等がある。

【0033】なお、本発明にかかる半導体固定用シートで積層される粘着剤は、一般に $5\sim70\mu$ mの厚みで形成される。これはあまりに厚いと加熱又は紫外線照射による硬化が遅くなりあまりに薄いと粘着力を高く設定できないためである。また、該粘着剤には従来公知の充填剤、老化防止剤、軟化剤、安定剤若しくは着色剤などを適宜選択して添加することができる。

【0034】本発明におけるシート状の上記支持体としては、一般に、種々の合成樹脂素材を採用でき、上記紫外線硬化型粘着剤を半導体ウエハ固定側に積層する場合には、該支持体を紫外線透過シートにして紫外線を粘着剤にまで届かせるものがよい。該支持体の素材としては、例えばポリ塩化ビニル、ポリブテン、ポリブタジエン、ポリウレタン、エチレン一酢酸ビニル共重合体、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリプロピレン等の単独層又は複数層がある。また、一般該支持体の厚みは10~500μmの範囲内から選択される。

【0035】なお、本発明にかかる半導体ウエハ固定用

シートは、必要に応じて粘着剤上にポリエチレンラミネート紙、剥離処理プラスチツクフイルム等の剥離紙又は 剥離シートを密着させて保存される。

[0036]

【発明の実施の形態】本発明にかかる半導体ウエハ固定 用シートは、シート状の支持体と、該支持体の一方の面 に積層された半導体ウエハ固定用粘着剤層で主要部 が構成された半導体ウエハ固定用シートにおいて、前記 半導体ウエハ固定用粘着剤層で主要部 が構成された半導体ウエハ固定用シートにおいて、前記 半導体ウエハ固定用粘着剤層又は前記シート固定用粘着 剤層のいずれか一方が加熱硬化型粘着剤であり、他方が 紫外線硬化型粘着剤であることを特徴とし、これにより 固定台剥離時には半導体ウエハ固定用シートをダイシン グ後の半導体ウエハチツプを飛散させずに剥離でき、さ らには半導体ウエハチツプをピツクアツプする際には容 易に該チツプをピツクアツプさせることができる。

[0037]

【実施例】本発明にかかる半導体ウエハ固定用シートの各実施例及びその比較例を図と表を用いて詳細に説明する。図1は各実施例及びその比較例の半導体ウエハ固定用シートを模式的に示した説明図であり、粘着力により固定した半導体ウエハをダイス状にダイシングした後の状態を示したものである。表1は実施例及びその比較例の粘着剤層の特徴となる配合物とその特性値を示したものである。また、表1における配合物の値は重量部であり、特性値におけるピツクアツプできたものを○、できないものを×とし、特性値における台剥離性は、半導体ウエハ固定用シートを固定台Dから剥離した際にダイシングされた半導体ウエハチンプHを脱落させなかったものを○、脱落させてしまったのを×とした。

[0038]

【表1】

	実施例		比 較 例						
		1	2	7	2	3	4	5	6
固定用	オリゴマ	40	30	30	40	40	40	5	40
	加熱重合開始剤	3	_		3	3	3	3	0.05
	紫外線重合開始剤		3	3	_	_	_	_	_
固定用	オリゴマ	30	40	30	40	3	30	30	30
	加熱重合開始剤		3		3				-
	紫外線重合開始剤	3		3	_	3		3	3
特性値	ピツクアツプ性	0	0	0	0	0	0	×	×
	台剥離性	0	0	×	×	×	×	0	0

【0039】第1実施例における半導体ウエハ固定用シートは、図1のように、シート状の支持体1と、該支持体1の一方の面に積層された加熱硬化型粘着剤からなる

半導体ウエハ固定用粘着剤層2と、該支持体1の他方の 面に積層された紫外線硬化型粘着剤からなるシート固定 用粘着剤層3とで主要部が構成されている。各粘着剤層 2、3の特徴的な配合は、表1の第1実施例に掲げた。 なお、図中、符号Hは半導体ウエハをチツプ状にダイシングしたものであり、Dはダイシング装置(図示省略) の固定台である。

【0040】表1におけるオリゴマは荒川化学工業社製ビームセツト575であり、加熱重合性開始剤はパーオキシジカーボネートとしての日本油脂社製パーロイルTCPであり、さらに紫外線重合開始剤はチバガイギー社製のイルガキュアー651である。

【0041】なお、表への記載を省略したが、各実施例及びその比較例におけるそれぞれの粘着剤には、主剤としてのベースポリマ(アクリルゴムとしての日本ゼオン社製Nipol AR53L)が100重量部配合され、粘着付与樹脂(テルペン樹脂としてのヤスハラケミカル社製YS RESIN 1250)が20重量部配合され、加熱重合開始剤を配合した場合には熱重合禁止剤(ハイドロキノンモノメチルエーテル)が0.01重量部配合され、紫外線重合開始剤を配合した場合には硬化剤(イソシアネート系硬化剤としての日本ポリウレタン工業社製のコロネート L)が3重量部配合されている。なお、上記支持体1は、ポリエチレンテレフタレートを採用した。

【0042】第1実施例にあっては、紫外線照射をした後、半導体ウエハ固定用シートを固定台Dから剥離しても、チツプ状の半導体ウエハHは脱落しなかった。また、チツプHのピツクアツプにあっては、前記剥離後ピツクアツプ前にシート全体を加熱することにより問題なくチツプをピツクアツプできた。

【0043】比較例1に、半導体ウエハ固定用粘着剤層2とシート固定用粘着剤層3のそれぞれに第1実施例と同じ紫外線硬化型粘着剤を採用した配合を示す。該比較例1にあっては、半導体ウエハ固定用シートをチツブHごと紫外線照射した後に固定台Dから剥離した場合、該剥離時に広範囲のチツプHが飛散してしまった。

【0044】第2実施例について説明する。本実施例は、第1実施例における半導体ウエハ固定用粘着剤層2 とシート固定用粘着剤層3の組成を入れ替えて積層した 半導体ウエハ固定用シートであり、上記支持体1は紫外 線透過性を有するポリエチレンテレフタレートを採用した。

【0045】この第2実施例にあっては、該半導体ウエハ固定用シートを加熱した後上記固定台Dから剥離しても、半導体ウエハチツプHが脱落しなかった。また、チツプHのピツクアツプにあっては、前記剥離後ピツクアツブ前にシート全体を紫外線照射することにより問題なくチンプHをピツクアツブできた。

【0046】比較例2に、半導体ウエハ固定用粘着剤層2とシート固定用粘着剤層3のそれぞれに第2実施例と同じ加熱硬化型粘着剤を採用した配合を示す。該比較例2にあっては、半導体ウエハ固定用シートをチンプHご

と加熱した後に固定台Dから剥離した場合、該剥離時に 広範囲のチツプHが飛散してしまった。

【0047】次に、第1実施例の構成(上記支持体1をポリエチレンテレフタレート、半導体ウエハ固定用粘着剤層2を加熱硬化型粘着剤、シート固定用粘着剤層3を紫外線硬化型粘着剤で形成した半導体ウエハ固定用シート)に基づいて粘着剤の組成を適宜変更した比較例について、表1を参照しつつ、詳細に説明する。

【0048】紫外線硬化型粘着剤の組成を適宜変更した例を比較例3、4に示す。オリゴマの配合比を少なくした比較例3、紫外線重合開始剤の配合比を少なくした比較例4では、共に半導体ウエハ固定用粘着剤層2の硬化速度が遅いため、半導体ウエハ固定用シートをチツプHごと紫外線照射した後に固定台Dから剥離しても、該剥離時に広範囲のチツプHが飛散してしまった。また、表での記載を省略したが、オリゴマ及び/又は紫外線重合開始剤の配合比をそれぞれ300重量部、5重量部より多くすると、紫外線硬化型粘着剤を積層した直後の状態では問題ないが、積層されていら光を受けると勝手に該紫外線硬化型粘着剤が硬化してしまうので、保存安定性の悪い製品しかできなかった。

【0049】加熱硬化型粘着剤の組成を適宜変更した例を比較例5、6に示す。オリゴマの配合比だけを少なくした比較例5、加熱重合性開始剤の配合比だけを少なくした比較例6は、共に熱硬化性に劣ったため加熱後も高い粘着力を有しピツクアツプ性が悪かった。なお、表での記載を省略したが、オリゴマ、加熱重合性開始剤の配合比をそれぞれ900重量部、10重量部より多くすると、製造時の乾燥工程(100℃、1分間)で熱重合してしまい製品としての要求品質を満たすことができなかった。

[0050]

【発明の効果】本発明にかかる半導体ウエハ固定用シートは、シート状の支持体と、該支持体の一方の面に積層された半導体ウエハ固定用粘着剤層と、該支持体の他方の面に積層されたシート固定用粘着剤層で主要部が構成された半導体ウエハ固定用シートにおいて、前記半導体ウエハ固定用粘着剤層又は前記シート固定用粘着剤層のいずれか一方が加熱硬化型粘着剤であり、他方が紫外線硬化型粘着剤であることを特徴とし、これにより固定台剥離時には半導体ウエハ固定用シートをダイシング後の半導体ウエハチツプを飛散させずに剥離でき、さらには半導体ウエハチツプをピツクアツプする際には容易に該チップをピツクアツプさせることができる。

【図面の簡単な説明】

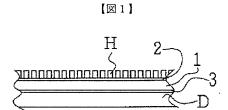
【図1】本発明にかかる半導体ウエハ固定用シートの実施例及びその比較例を模式的に示した説明図である。

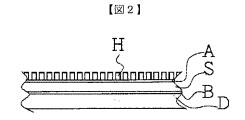
【図2】従来の半導体ウエハ固定用シートを模式的に示した説明図である。

【符号の説明】

- 1 支持体
- 2 半導体ウエハ固定用粘着剤層

3 シート固定用粘着剤層





フロントページの続き

(72) 発明者 林 隆史

神奈川県鎌倉市台2丁目13番1号 東洋化 学株式会社内